

NIMS微細加工プラットフォーム 利用料金表

※平成26年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	分類	装置名	機器利用	技術補助・技術代行
1	リングラフィ	125kV電子ビーム描画装置	¥5,000	¥7,100
2		100kV電子ビーム描画装置	¥3,000	¥5,100
3		高速マスクレス露光装置	¥2,000	¥4,100
4		レーザー露光装置	¥1,000	¥3,100
5		ナノインプリント装置	¥1,000	¥3,100
6		マスクアライナー	¥1,000	¥3,100
7		CAD作成	設定なし	¥3,100
8	薄膜形成	全自動スパッタ装置	¥1,000	¥3,100
9		超高真空スパッタ装置	¥1,000	¥3,100
10		12連電子銃型蒸着装置	¥1,000	¥3,100
11		超高真空電子銃型蒸着装置	¥1,000	¥3,100
12		原子層堆積装置	¥1,000	¥3,100
13		プラズマCVD装置	¥1,000	¥3,100
14	ドライエッチング	多目的ドライエッチング装置	¥1,000	¥3,100
15		化合物ドライエッチング装置	¥1,000	¥3,100
16		シリコン深堀エッチング装置	¥1,000	¥3,100
17		酸化膜ドライエッチング装置	¥2,000	¥4,100
18	FIB加工	FIB-SEMダブルビーム装置	¥3,000	¥5,100
19	熱処理	急速赤外線アニール炉	¥1,000	¥3,100
20		シリコン酸化・熱処理炉	¥1,000	¥3,100
21	観察・評価	走査電子顕微鏡	¥1,000	¥3,100
22		原子間力顕微鏡	¥1,000	¥3,100
23		3次元測定レーザー顕微鏡	¥1,000	¥3,100
24	切削・研磨	ダイシングソー	¥1,000	¥3,100
25		自動スクライパー	¥1,000	¥3,100
26		CMP研磨装置	¥1,000	¥3,100
27	電気計測	室温プローブシステム	¥1,000	¥3,100
28		極低温プローブシステム	¥1,000	¥3,100
29		ワイヤーボンダー	¥1,000	¥3,100
30	ウェットプロセス	基板洗浄プロセス	設定なし	¥3,100
31		リフトオフプロセス	設定なし	¥3,100
32		レジスト剥離プロセス	設定なし	¥3,100
33		ウェットエッチング	設定なし	¥3,100

本表料金は「成果公開利用」に限り適用

「大学・公的研究機関」所属の方は、本表料金×0.5

【備考】

1. 本表は1時間当たりの装置利用に係る金額であり、これに利用時間(※)を乗じ、消費税を付加した金額が利用料金となります
2. 30分未満の利用については30分として算出し、以後30分単位で利用料金を算出します
3. 利用時間は装置予約時間に準じます(装置立ち上げ時間・終了作業時間含む)
4. CAD作成およびウェットプロセスの利用時間は、スタッフ作業時間に準じます
5. NIMS内部利用者(ナノ融合STナノ集積ライン利用者)は、本表×0.5の料金単価とする

※ 利用時間について・・・

仮に3時間予約して、実際の装置使用時間が2時間であった場合も3時間分の料金が発生します

また、予約時間を超過して利用した場合は、超過分の追加料金が発生します